## 4Pa60

## QUEST電極配位におけるCHI生成電流の発展 Evolution of CHI-produced current on QUEST electrode configuration

黑田賢剛<sup>1</sup>, Roger RAMAN<sup>2</sup>,花田和明<sup>1</sup>,長谷川真<sup>1</sup>,恩地拓己<sup>1</sup>,小野雅之<sup>3</sup>,Thomas JARBOE<sup>2</sup>, Brian A. NELSON<sup>2</sup>,永田正義<sup>4</sup>,御手洗修<sup>5</sup>,出射浩<sup>1</sup>,John ROGERS<sup>2</sup>, Canbin Huang<sup>1</sup>, 川崎昌二<sup>1</sup>,永田貴大<sup>1</sup>,小島 信一郎<sup>1</sup>,東島亜紀<sup>1</sup>,中村一男<sup>1</sup>,高瀬雄一<sup>6</sup>,村上定義<sup>7</sup> Kengoh KURODA<sup>1</sup>, Roger RAMAN<sup>2</sup>, Kazuaki HANADA<sup>1</sup>, Makoto HASEGAWA<sup>1</sup>, Takumi ONCHI<sup>1</sup>, Masayuki ONO<sup>3</sup>, Thomas JARBOE<sup>2</sup>, Brian A. NELSON<sup>2</sup>, Masayoshi NAGATA<sup>4</sup>, Osamu MITARAI<sup>5</sup>, Hiroshi IDEI<sup>1</sup>, John ROGERS<sup>2</sup>, Canbin Huang<sup>1</sup>, Shoji KAWASAKI<sup>1</sup>, Takahiro NAGATA<sup>1</sup>, Shinichiro KOJIMA<sup>1</sup>, Aki HIGASHIJIMA<sup>1</sup>, Kazuo NAKAMURA<sup>1</sup>, Yuichi TAKASE<sup>6</sup>, Sadayoshi MURAKAMI<sup>7</sup>

<sup>1</sup>九州大学,<sup>2</sup>ワシントン大学,<sup>3</sup>プリンストンプラズマ物理研究所,<sup>4</sup>兵庫県立大学, <sup>5</sup>先進核融合・物理教育研究所,<sup>6</sup>東京大学,<sup>7</sup>京都大学 <sup>1</sup>Kyushu University, <sup>2</sup>University of Washington, <sup>3</sup>Princeton Plasma Physics Laboratory, <sup>4</sup>University of Hyogo, <sup>5</sup>Institute for Advanced Fusion and Physics Education, <sup>6</sup>University of Tokyo, <sup>7</sup>Kyoto University

現在九州大学の球状トカマク装置QUESTにお いて同軸ヘリシティ入射(CHI)手法による電流 立ち上げ評価が行われている。核融合炉への導 入を想定して新設計された簡易型のQUEST電 極配位においてCHI電流駆動を成功させ、 QUESTの主要加熱法であるECHとの組み合わ せ加熱を実現させる。これまでの実験ではこの QUEST電極配位においてプラズマは安定に着 火して、ポロイダル磁場(PF)コイルによる磁場 配位に応じた発展が観測された。現状の課題は 適切な発展を生じさせ、明確な閉磁気面を形成 することであり、本発表ではそのためのPFコイ ル条件の算出結果について報告する。CHIでは 電極からの入射電流がプラズマを形成し、これ が外部磁場との相互作用により大きく発展す る。この際、低圧力(~1Pa)の閉磁気面形成段階 において、~数10kAの入射電流はjXB=0のフォ ースフリー状態に至ると推測した。すなわち、 発展形状において電極面からの入射電流パス は形成磁場の磁力線と一致するはずであり、そ の形状解を数値的に算出することにより閉磁 気面形成に至る発展のための外部磁場条件の 見積りを試みた。真空容器全面により電極が構 成されるNSTXなどの従来のCHI電極に対して、 新設計のQUEST電極では下部ダイバーター上 に円環板状のバイアス電極(内径430mm, 外径 850mm)が設置され、真空容器に対してこのバイ アス電極に電圧が印加される。したがって電流 はこの狭い電極領域内から入射されることに なり、ここから出発する磁力線に沿った電流パ スを算出する。図1に示すようにイタレーショ ン手法により概算した電流パスの発展形状は 実験結果とよく一致した。しかし実験結果と同 等の発展が生じるための入射電流値、及びその 時のトロイダル電流値は実験値と大きく異な った。これらの算出値はバイアス電極上の入射 電流分布に大きく依存し、正確な数値予想を行 うためには今後この分布について(計測による 見積り値、プラズマ特性との関連性など)調べる 必要がある。図1の計算は磁束密度Bzに比例し た電流密度を仮定しており、実際は電極外側に より多くの電流が流れることを示唆する。図1 の入射電流パスは電極及び容器との両端の接 続部が大きく離れてしまっている。発展後に入 射電流の急速な立ち下げにより両端の接続を 切り離し、磁束の繋ぎ変えを経て閉磁気面を形 成させるため、この接続部間幅が狭く維持され るPFコイル条件について算出を行った。



図1 QUEST電極配位における異なるPFコイル条件 のCHIプラズマ発展。実験における放電画像(左写真) と数値概算結果(左図,太線;電流パス,細線;磁束)